(19) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 173499
(43) วันประกาศโฆษณา 22 กุมภาพันธ์ 2561

(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ยื่นผ่านระบบพีซีที

(21) เลขที่คำขอ 1701003079
(24) วันที่รับคำขอ 2 มิถุนายน 2560
(22) วันที่ยื่นคำขอ 5 ธันวาคม 2557

(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10
H05H 1/24
(89) เลขที่คำขอพีซีที PCT/US2014/068858

(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
-
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-

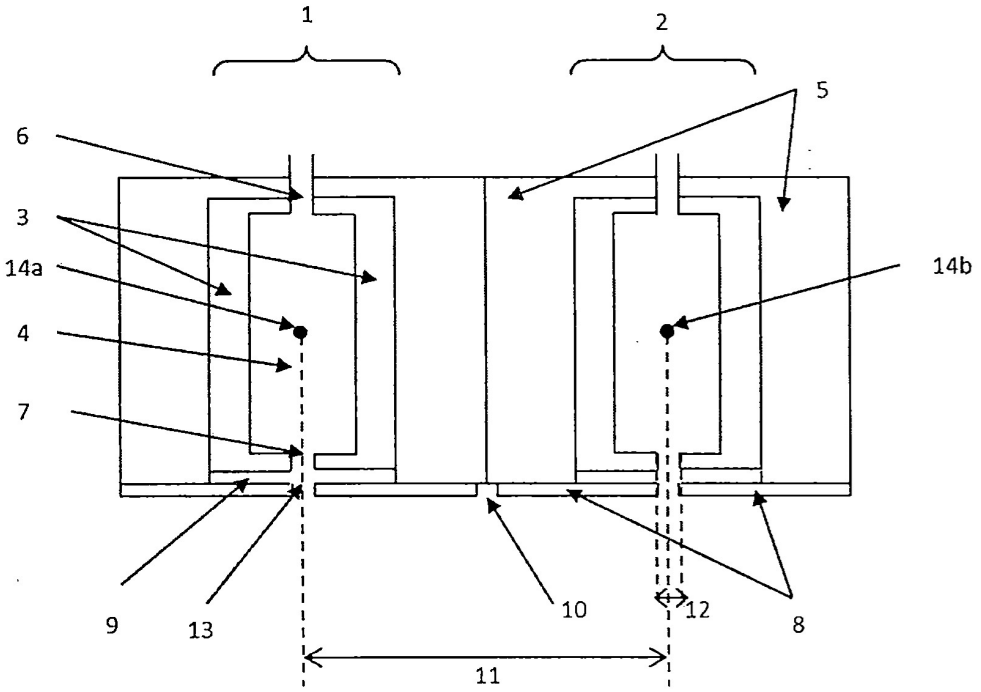
(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
เอจีซี แฟลต กลาส นอร์ธ อเมริกา, อิงค์.
เอจีซี กลาส ยุโรป, เอส.เอ
อาซาฮี กลาส โค., แอลทีดี.
(72) ผู้ประดิษฐ์
นายโทมัส ปีเก้ และคณะ
(74) ตัวแทน
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ และ/หรือ นางสาวสนธยา สังขพงศ์ และ/หรือ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง
แห่ง บริษัท ดิลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20-26
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แหล่งพลาสมาชนิดแคโทดกลวง

(57) บทสรุปการประดิษฐ์

การประดิษฐ์ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับแหล่งพลาสมาชนิดแคโทดกลวง (hollow cathode plasma source) และเกี่ยวข้องกับวิธีการปรับสภาพผิวหรือวิธีการเคลือบผิวโดยใช้แหล่งพลาสมาดังกล่าว ซึ่งประกอบรวมด้วยขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่หนึ่งและที่สอง (1, 2) ขั้วไฟฟ้าแต่ละขั้วประกอบรวมด้วยโพรงยาว (elongated cavity) (4) ที่ซึ่งมิติสำหรับพารามิเตอร์ต่อไปนี้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งข้อถูกเลือกเพื่อทำให้เกิดความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่สูงและ/หรือปริมาณที่ต่ำของการฉาบด้วยโลหะ (sputtering) ของพื้นผิวโพรงแหล่งพลาสมา โดยที่พารามิเตอร์เหล่านี้คือรูปร่างภาคตัดขวางของโพรง, พื้นที่หน้าตัดของโพรง, ระยะทางของโพรง (11), และความกว้างของหัวฉีดออก (12)

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 173499



(ข้อถือสิทธิ 11 ข้อ, รูปเขียน 5 รูป)